

AWC[®] UF-427

Limpiador Oxigenado de alto pH para
para Membranas UF/MF

VENTAJAS

- Formulación en polvo de alto poder específicamente diseñada para remover fuerte ensuciamiento orgánico de la superficie y poros de membranas MF/UF
- Penetra y remueve películas biológicas
- Dispersa las partículas inorgánicas tales como lodo, arcilla, sílice y otras partículas coloidales
- Remueve polímeros, aceites emulsionados, tinturas y colores orgánicos de la superficie de la membrana
- Bufferado para mantener un rango de pH estable incluso cuando ocurre una sobredosis accidental
- Compatible con la mayoría de módulos de microfiltración y ultrafiltración
- Certificado por NSF bajo la norma NSF/ANSI 60

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	Polvo Blanco Cristalino
Olor	Sin olor
Solubilidad en Agua	Soluble
pH (solución al 2%)	10.6 ± 0.4
Contenido de Peróxido (solución al 1%)	1000 ppm as H ₂ O ₂

EMPAQUE

Contenedores plásticos de 50 libras o 400 libras

SEGURIDAD Y MANEJO

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga los contenedores cerrados. Lave las ropas contaminadas antes de re-utilizar. Para mayor información, por favor ver la hoja de seguridad (HDS) suministrada con el producto.

ALIMENTACIÓN QUÍMICA Y CONTROL

La solución limpiadora debe ser preparada usando filtrado MF/UF. Para mejores resultados evitar usar agua de alta dureza. Preparar la solución usando 17 lb. de AWC UF-427 por cada 100 galones de agua (Solución al ~2 wt%). Para alto ensuciamiento, se recomienda un tiempo mínimo de limpieza de 3 horas. Calentar la solución a la temperatura máxima permitida por el fabricante del módulo, mejorará los resultados de limpieza.

Procedimientos de limpieza es como sigue:

- Circular la solución de limpieza a través de los módulos con la válvula del filtrado cerrada, en la dirección de alimentación por 30 minutos (para diseños tubulares).
- Alternar con remojo por 30 minutos.
- Reversar la dirección del flujo y recircular por 30 minutos más.
- Repetir pasos 1 – 3.

Si el pH disminuye por debajo del rango objetivo de 10.5 -11.5, adicione más AWC UF-427 para mantenerlo en el rango durante todo el proceso de limpieza. No exceda el tiempo de exposición a limpiadores de alto pH recomendadas por el fabricante de membranas y no exceda la tolerancia a peróxido de hidrógeno de la membrana. Si el retro-lavado es permitido por el fabricante, los resultados de la limpieza pueden ser mejoradas por un retro-lavado de la solución desde el lado de filtrado a lado de alimentación por 15 minutos. Después de terminar la limpieza, los módulos deben ser enjuagados con filtrado MF/UF.

